大バンチ電荷スタディー

2015年7月30日(木)9時30分~9時50分 KEKつくばキャンパス 4号館2階輪講室1

宮島 司 高エネルギー加速器研究機構 (KEK) 加速器研究施設

Outline

- 1. 高バンチ電荷スタディの目標設定
- 2. 2015年1月~6月までの高バンチ電荷スタディ結果
- 3. 性能向上に向けた対策

### cERL mini WS における議題

- cERLを構成する各要素について
  - これまでの進捗状況
  - cERLの運転を通して、何が達成できたのか?
  - 今後の残された課題は?
  - その課題を克服するための見通しは?

- 今回の報告事項
  - 大バンチ電荷運転について、上記の項目を紹介する

### 高バンチ電荷スタディの目標設定

#### □空間電荷効果について

- エネルギーが低いと顕著になる
- バンチ電荷密度が上がると強くなる

#### **ロ**2014年6月までの高バンチ電荷スタディ

- 入射器単体(5.6 MeV): < 1 mm mrad のエミッタンス
- 周回運転(2.9 MeV): 5 mm mrad 程度まで悪化

#### □<u>今回の目標</u>

- 低エネルギー領域: 輸送条件の徹底した調査
- 周回部輸送: 入射エネルギーを上げて、エミッタンス低減

# ERL加速器のビーム性能目標

### • <u>3 GeV ERL光源で想定される運転モード</u>

High-coherence mode High-flux mode Beam energy 3 GeV 100 mA Average beam current 10 mA **Bunch charge** 7.7 pC 77 pC Repetition rate of 1.3 GHz bunch Normalized emittance 0.1 mm mrad 1 mm mrad Emittance at full beam 17 pm rad 170 pm rad energy  $2 \times 10^{-4}$  $2 \times 10^{-4}$ Energy spread Bunch length 2 ps 2 ps

- 挑戦的な値はどれか?
  - 平均ビーム電流 100 mA
  - 規格化エミッタンス 0.1 mm mrad
- <u>平均ビーム電流 100 mA</u>
  - これだけの電流を生成し続ける
     電子源開発が必要
  - さらにこれを加速し続ける加速空 洞開発が必要
- <u>0.1 mm mradのエミッタンス</u>
  - この小さい初期エミッタンスを実 現するカソード材質
  - これを悪化させない
     輸送法(空間 電荷効果:クーロン斥力の
     が鍵)



• ERL加速器のビーム性能

#### <u>上流(電子銃、入射器)で高品質ビームを</u> 生成し、悪化させないことが本質

- 線形加速器なので入射器のビーム品質が、加速
   器全体のビーム品質に影響
- エネルギーが低いので空間電荷効果の補償が鍵

空間電荷効果(エネルギーとバンチ電荷)

<u>空間電荷効果(単純な円筒モデルの場合で説明)</u>

$$F_r = e(E_r - vB_\theta) = \frac{1}{2} \frac{e}{\varepsilon_0} \frac{\rho_0}{\gamma^2} r$$



▶ 1/γ<sup>2</sup> に比例: 低エネルギー領域で影響が大きい 電荷密度に比例: 電荷密度を上げると影響が大きくなる

- 低バンチ電荷: 空間電荷効果がないので2次元面(水平、垂直方向)と時間方向は独立
- 高バンチ電荷: 空間電荷効果を通してお互いが独立ではなくなる
   ⇒ 高バンチ電荷では3次元形状を精密に制御しなければならない



# 2014年6月までの高バンチ電荷運転

### • 2013年6月

- 入射器単体(5.6 MeV)、診断部輸送
- 規格化エミッタンス(測定値): 0.8 mm
   mrad以下

規格化エミッタンスの測定結果 ( $\varepsilon_{nx} / \varepsilon_{ny}$ ), 単位 mm mrad

運転モード	(1)入射器 診断部
7.7 pC(短パルス)	0.8 / 0.5
7.7 pC(長パルス)	0.7 / 0.7

- 2014年6月
  - 入射器(2.9 MeV)、周回部(20 MeV)、周 回部輸送
  - 規格化エミッタンス(測定値): 2.4-5.8 mm mrad

規格化エミッタンスの測定結果 ( $\varepsilon_{nx} / \varepsilon_{ny}$ ), 単位 mm mrad

運転モード	(1)入射器 診断部	(2) 主空洞 出口	(3) 第一 アーク後
20 fC	-	0.14 / 0.12	0.14 / 0.14
7.7 pC	2.5 / 2.9	2.9 / 2.4	5.8 / 4.6





入射器単体(5.6 MeV): ある程度低いエミッタンスが得られている 周回部輸送(2.9 MeV): エミッタンスの悪化が顕著

## 高バンチ電荷スタディの目標設定

- これまでの結果
  - 入射器 5.6 MeV 運転:

エミッタンス増加は小さい

— 入射器 2.9 MeV 運転:

エミッタンス増加がかなり大きい

- そもそもなぜ入射器2.9 MeV運転か?
  - エネルギー回収運転のためには、入射シケイ ンを通すために、入射エネルギーを下げる必 要があった
- 今回の方針
  - 電子銃から入射器入口の低エネルギー区間 (T = 390 keV)での徹底した調査(輸送条件は どのようになっているか?)
  - 入射器エネルギーを 5.4 MeV に上げて周回 部に輸送し、周回部のエミッタンスが下がる ことを確認する(ただし、エネルギー回収はで きないため、周回部FCでビームを止める)



この磁石を入射(エネルギー低)、周回(エネル ギー高)の2つのビームが通過。 エネルギー比が近いと周回ビームのバンプがどん どん高くなり、チェンバー内壁に当たる。 主空洞が下がると、入射空洞も下げざるをえない。 現状は1:6が下限(これより大きくしたい)



# 2015年1月~6月までの高バンチ電荷スタディ結果 ~運転全般について~

#### □運転全般: 高バンチ電荷スタディ実施日

- 2015年3月に2日間
- 2015年6月に2週間

#### □入射器エネルギーの増強

- 2.9 MeV ⇒ 5.4 MeV
- 開始当初は問題なかったが、空洞のフィールドエミッションが増加
- 最終的に 2.9 MeV までエネルギーを下げた

### 高バンチ電荷スタディの運転経過

- 2015年3月
  - 3/17, 3/30 の2日間スタディを実施、低エネルギー領域の輸送条件の調査
- ・ 2015年6/8の週
  - 6/8(月):INJ#1-3:7 MV/mでEinj = 5.45 MeVまで加速
  - 6/9(火):診断部へ輸送、プロファイルの歪み調査
  - 6/10(水):主空洞位相調整、周回部輸送調整、プロファイルの回転が問題
  - 6/11(木): INJ\_CAV#3で放電発生、FB2: 7 MV/m -> 5.5 MV/m へ下げる(Einj = 4.89 MeV)
  - 6/12(金): Einj = 4.89 MeVで周回部輸送、周回部FCまで到達
- 2015年6/15の週
  - 6/15(月): 周回部でエミッタンス測定(2-4 mm mrad)、バンチャー付近で放電が見られる
  - 6/16(火): 周回部バンチ長測定(3 ps), cam1, cam2 でのプロファイル変化の調査を実施
  - 6/17(水): INJ\_CAV#1からも放電が発生、Einj = 2.9 MeVに下げる調整を実施
  - 6/18(木):レーザー直径d = 1 ⇒ 2 mmに変更した条件を計算、0.5 pCのCW調整を実施
  - 6/19(金):0.5 pC, CW 運転調整
- ・ 2015年6/22の週
  - 6/22(月):d=2mm, Einj=2.9 MeV, 7.7 pC診断部輸送、エミッタンスとバンチ長応答を測定
- 2013年3月の運転では問題なかったが、今回は入射器 Eacc = 7 MV/m運転 を継続できなかった
- 一度空洞で放電が始まると、Gun-FCの絶縁セラミックでチャージアップ⇒放電 が起き、それがまた空洞の放電を引き起こすという悪循環となった
- 加速器を総合的に考えて、運転調整を行わないといけないと痛感

# 2015年1月~6月までの高バンチ電荷スタディ結果 ~ 低エネルギー領域の輸送条件の測定~

#### □低エネルギー領域の輸送条件

- 電子銃から入射器空洞までの輸送条件を調査
- ソレノイド電磁石、軌道補正電磁石の応答を測定
- バンチ電荷を上げるとプロファイルが歪む

### 電子銃から入射器空洞までの輸送条件の測定

- この区間の運動エネルギーは 390 keV
- エネルギーが低いため、空間電荷効果だけでなく、環境磁場等の外乱に影響されやすい
- 目的: この区間の輸送条件を設計条件に近づける(あるいはモデルを修正する)

スクリーンモニタ2 (cam2) スクリーンモニタ1 (cam1)



# 高バンチ電荷におけるプロファイルの歪み

- バンチ電荷 7.7 pC でプロファイルを測定
- Cam1でプロファイルの非対称性が観測された(本来は軸対称がある)
- ・ これが、cam2まで行くと拡大されて四角いプロファイルになる
- さらに、入射器空洞下流でのプロファイルの回転の原因にもなる

バンチ電荷を上げた結果、空間電荷効果によってプロファイルが拡がり、環境磁場等の 非一様磁場の影響を受け、プロファイルが歪んでいると推測される

 ソレノイドの中心通し、ステアリングの磁場を下げる調整によって、可能な限り 丸いプロファイルに近づけた

Cam1のプロファイル(SL1の)電流をかえたとき



7.7 pCでは、8-9 Aの励磁電流を使うので、そんなに悪くない状態まで持ってこれた

### プロファイルの歪みへの対策

- 磁場の非対称性に起因する場合、中心軸からずれるとその影響が強くなると推測される
- 電子銃からSL1までの区間のビームサイズは、空間電荷効果による発散力に支配されるため、ソレノイド等で修正することができない
- 代わりに、励起レーザー直径を大きくして空間電荷力を弱めて、この区間のビームサイズを下げた場合に、プロファイルの非対称性がどうなるかを測定したい
- ただし、初期エミッタンスが増加するというデメリットがある
- ・ 励起レーザー直径 d = 1.2 mm(通常設定), 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mmについて粒 子トラッキングコードGPTを用いてビームサイズを計算した



励起レーザー直径の影響



d = 1.2 mm ⇒ 2.0 mm にした場合、SL1の位置でstdx = 4 mm ⇒ 3 mm と小さくなる d = 2.0 mm の場合について、非対称性が改善されるか見てみたい

# レーザー直径 2 mm運転のプロファイル





- 2 mm に変えた結果、プロフ ァイルの非対称性は改善さ れた ⇒ 電荷密度を下げて ビームサイズを抑えることは 効果がある
- ただし、完全に軸対称になっ ていないので、まだ影響が残 っている
- 今後の対策
  - - 電荷密度の低減(時間方向 にバンチ長を伸ばして、電 荷密度を下げる)
  - 軌道補正コイルの応答測定
     結果から、非対称性の磁場
     を見積もり、それを補正する
     方法を検討する

15

# 空間電荷効果のモデルの検証(d=1mm)

- バンチ電荷を変えてソレノイドスキャンを実施
- モデルとの比較を実施した





### 空間電荷効果のモデルの検証(d=2mm)

#### 0.54 pC/bunch

初期レーザーパルス長: 3 ps レーザー直径: 2 mm

ほぼモデルで実験結果を再現できている 過収束したあと、XYの非対称性が見える

7.6 pC/bunch

初期レーザーパルス長: 3 ps レーザー直径:2 mm

空間電荷効果のビームサイズに対する影響 ⇒ モデルで再現できることが確認された

次は、プロファイルを含めて設計条件に 合わせるように調整していくことが必要



### 2015年1月~6月までの高バンチ電荷スタディ結果 ~周回部輸送調整~

#### □周回部輸送調整

- 入射エネルギー: 2.9 MeV ⇒ 5.4 MeV へ増強
- スタディ途中で、入射器空洞のフィールドミッション発生
- 5.4 MeV ⇒ 4.9 MeV に下げて、周回部輸送(エミッタンス測定)
- 入射器空洞フィールドエミッションが悪化、2.9 MeV に戻した

入射エネルギー 4.9 MeV 周回部輸送条件

入射器4.89 MeV、周回部輸送(電子銃から主空洞出口までの輸送条件)



<u>主空洞出口のビーム条件</u> 規格化 rms エミッタンス(設計値): 0.5 mm mrad rms バンチ長: 3 ps

19



宮島 司

# 周回部エミッタンス測定(第一アーク手前) 測定結果 ②主空洞後~第1アーク

- QMAM02とMS13を使用(Gain0, ND4, BG補正)
- 57.5 um/pix, QMAM02~MS13: 4053 mm (thick lens), 19.4 MeV
- 規格化エミッタンス  $\Rightarrow$   $\epsilon_x = 1.90 \pm 0.02 \text{ um}, \epsilon_y = 2.39 \pm 0.03 \text{ um}$
- 途中プロファイルが回転したり2ピークになることがあった
- 第1アーク後よりは小さい傾向?



# 周回部エミッタンス測定(周長補正シケイン手前) 測定結果 ①第1アーク~周長補正シケイン

- QMIM02とMS18を使用(Gain0, ND4, BG補正)
- 57.7 um/pix, QMIM02~MS18: 5888 mm (thick lens), 19.4 MeV
- 規格化エミッタンス  $\Rightarrow \epsilon_x = 4.5 \pm 0.1 \text{ um}, \epsilon_y = 4.5 \pm 0.6 \text{ um}$
- 前回(2014/6)よりは素直な応答



2015年6月17日(水)高井さん資料より



### 性能向上に向けた対策

#### □低エネルギー領域のプロファイル補正

- レーザー導入ミラーのチャージアップ対策
- 環境磁場の非一様性の補正
- バンチ電荷密度の低減(初期バンチ長の伸長)

#### □入射器空洞下流

- 入射器空洞の電磁場モデルの修正(3次元+非対称性)
- 入射器空洞CAV#1の加速勾配の上昇(エミッタンス補償)
- (入射エネルギー増強試験の続き)

レーザー導入ミラーのチャージアップの可能性

- 80 µA CW 運転を継続していると、徐々にビーム位置がドリフトしていることが確認 された ⇒ レーザー導入ミラーが徐々にチャージアップして、低エネルギービー ムに影響を与えている可能性があることが指摘された
- レーザー導入ミラーがチャージアップしたと過程して、cam1, cam2のビームプロファイルにどのような影響があるかをシミュレーション(GPT)で評価した
- レーザーミラーの位置付近に点電荷を配置(Q1, Q2)
- 今回は、Q = Q1 = Q2 (Q < 0)として、Qを変えた時の影響を計算</li>
- レーザー直径d = 1.2 mm
- 輸送条件
  - 0.5 pC 輸送
  - 7.7 pC輸送
- 計算条件

宮島 司

- 空間電荷効果あり: 3d-mesh



### Laser導入部内部(真上から見た写真)



#### CW運転前後のcam2位置でのビーム位置変化(1)



2 nC

-1.5 -2.0 -2.5 -3.0

34...

実際のチャージアップ量はまだ見 積もれていないが、電荷がいること によってプロファイルが歪むことは 確認できた。 次、楕円の縦横比で比較してみる

100 pC

宮島 司

Ê o

position=1.37223

x (mm)

10

Ó

2 3

#### 7.7 pCのとき(d = 1.2 mm) 実験結果



### シミュレーション(2 nCチャージアップと仮定)





7.7 pCの場合にも、チャージ アップによってプロファイルが影 響を受けることが示された

ただし、単純にチャージアップだけではなくて、磁場の非一様性による非線形効果も絡んでいると思われる

#### cERL mini workshop 2015年7月30日

15

# 性能向上に向けた対策

### 課題

- 電子銃~入射器空洞入口間(cam1, cam2)のプロファイルの歪み
  - 夏に金属ミラーへ交換し、チャージアップを抑制
  - この区間の望まない磁場の推定と補正方法(追加コイル、あるいはコイルの有効範囲の拡大)の検討
  - 外部磁場の遮蔽(どのように対策するか?)
  - エネルギー増強(390 kV ⇒ 500 kV、現在改造中)
  - 電荷密度を下げる対策(RF位相をある程度制御できそうなことが確認できたの で、パルススタッキングを導入する)
- 入射器空洞出口でのプロファイルの増大
  - 入射器空洞の3次元電磁場計算(現在は2次元分布で計算)
  - CAV#1の加速勾配の上昇: 3.3 MV/m ではエミッタンス補償とビームサイズ制御の両立が難しい、4 MV/m 程度で良い輸送条件がないか検討する(以前に、 CAV#1では勾配を下げた方がエミッタンス補償に良いという結果を示したが、 15 MV/mに比べて下げた方が良いというはなしで、3.3 MV/m では低すぎる)
  - SL1, バンチャー, SL2の軌道調整
  - ・ (加速勾配の上昇による、エネルギー増強)



まとめ

- 2015年1月~6月に、高バンチ電荷(7.7 pC)スタディを実施した
- 低エネルギー領域の輸送条件(390 keV 領域)
  - バンチ電荷 7.7 pC ビームのソレノイドスキャンを実施し、モデルで再現できることを確認した
  - プロファイルが円形状からずれる ⇒ 電荷密度を下げることで緩和できることを確認した
- 周回部輸送調整
  - 入射エネルギー 5.4 MeV に増強して輸送試験を試みる
  - が、入射器空洞のフィールドエミッションにより、エネルギーを下げることになった
  - 4.9 MeV 運転で、規格化 rms エミッタンス 4.5 mm mrad
- 性能向上に向けた対策
  - プロファイルの歪み:
    - ・ レーザー導入ミラーを金属製に交換
    - 軌道補正コイルの応答測定からプロファイルを歪める磁場の推定
    - 電子銃電圧増強(390 ⇒ 500 kV)
  - 周回部輸送でのエミッタンス悪化
    - 入射器空洞モデルの3次元化によるモデル化精度の向上(XY非対称を再現できるように)
    - エミッタンス補償条件の改善: 入射器空洞CAV#1の加速勾配の増強(フィールドエミッションが増大しない範囲で)

### Buck up slides

ミラーのチャージアップまとめ

- 0.5 pC, CW運転の前後でプロファイルが変化するのを再現できるか、シミュレーションで検証してみた
- nC 程度チャージアップするとプロファイルが歪むことがわかった
- 次は、測定結果から楕円の縦横比を計算してシミュレーションからチャージアップ量を見積もってみる
- 7.7 pCのときにも同様の計算を行ってみた(ただし、レーザー直径は d = 1.2 mm)
- 7.7 pCの場合も、nC程度チャージアップすると、プロファイルが歪むことが 確認できた
- 仮に電荷量を上げるためにレーザー強度を上げた結果、ミラーのチャージアップが起きているとしたら、7.7 pCのときにもミラーを交換した効果によって、プロファイルの非対称性が改善される可能性がある
- ただし、単純にチャージアップだけでは実験のプロファイルは再現できないため、これに磁場の非一様性による非線形が絡んでいると思われる
- ステアリングの応答測定等から、非線形成分を推定して、シミュレーションを行ってみる